

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2014 年 8 月 7 日(07.08.2014)



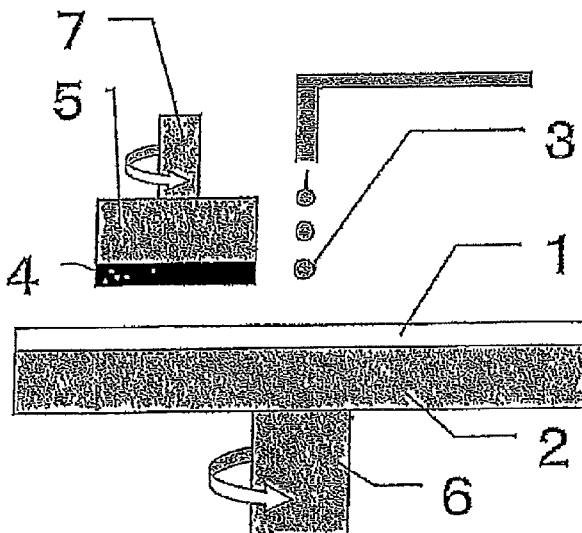
(10) 国際公開番号

WO 2014/119390 A1

- (51) 国際特許分類:  
B24B 37/24 (2012.01) C08J 5/14 (2006.01)  
C08G 18/10 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/050820
- (22) 国際出願日: 2014 年 1 月 17 日(17.01.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2013-017363 2013 年 1 月 31 日(31.01.2013) JP
- (71) 出願人: 東洋ゴム工業株式会社(TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 清水 紳司(SHIMIZU, Shinji); 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人 ユニウス国際特許事務所 (UNIUS PATENT ATTORNEYS OFFICE); 〒5320011 大阪府大阪市淀川区西中島 5 丁目 1 3 - 9 新大阪MTビル 1 号館 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:  
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: POLISHING PAD

(54) 発明の名称: 研磨パッド



(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide a polishing pad which comprises a polishing layer having a triple phase separation structure and has a high polishing rate and excellent planarization characteristics, while being capable of suppressing the occurrence of scratches. A polishing pad of the present invention comprises a polishing layer, and the polishing layer is formed of a reaction cured body of a polyurethane starting material composition that contains: an isocyanate-terminated prepolymer (A) which is obtained by reacting a prepolymer starting material composition (a) that contains an isocyanate component and a polyester polyol; an isocyanate-terminated prepolymer (B) which is obtained by reacting a prepolymer starting material composition (b) that contains an isocyanate component and a polyether polyol; and a chain extender. The polyether polyol contains a polyether polyol (C) that has a number average molecular weight of 1,000 or less and a polyether polyol (D) that has a number average molecular weight of 1,900 or more. The reaction cured body has a triple phase separation structure.

(57) 要約:

[続葉有]



本発明は、3相分離構造を有する研磨層を有しており、研磨速度が大きく、平坦化特性に優れ、スクラッチの発生を抑制できる研磨パッドを提供することを目的とする。本発明の研磨パッドは研磨層を有しており、前記研磨層は、イソシアネート成分及びポリエステル系ポリオールを含むプレポリマー原料組成物(a)を反応して得られるイソシアネート末端プレポリマー(A)、イソシアネート成分及びポリエーテル系ポリオールを含むプレポリマー原料組成物(b)を反応して得られるイソシアネート末端プレポリマー(B)、及び鎖延長剤を含むポリウレタン原料組成物の反応硬化体により形成されており、前記ポリエーテル系ポリオールは、数平均分子量1000以下のポリエーテル系ポリオール(C)及び数平均分子量1900以上のポリエーテル系ポリオール(D)を含み、前記反応硬化体は3相分離構造を有する。